

## 4 - Deposição de Filmes por Evaporação Térmica

### Motivação

#### ■ Aplicações

- Evaporação de metais - contatos elétricos/espehos
- Multicamadas ópticas / filtros interferométricos
- Deposição de semicondutores e isolantes: dispositivos:
  - Processamento
  - Memória
  - LEDs / Lasers

### Motivação

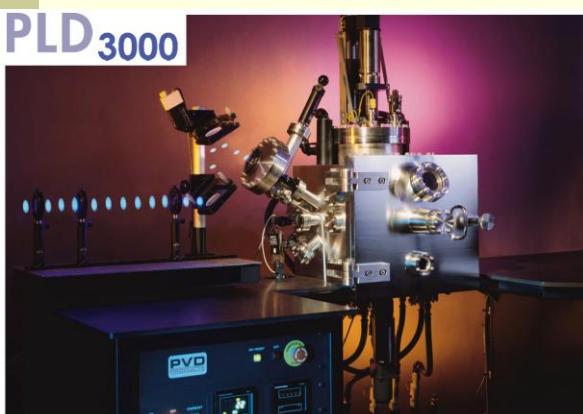
#### ■ Tecnologias / sistemas utilizados

- Sistemas de MBE – multicamadas eletrônicas
- Deposição por laser pulsado (PLD)
- Deposição por feixe eletrônico (e-beam)
- Deposição de compostos e ligas (flash)
- Evaporação térmica convencional

### Motivação

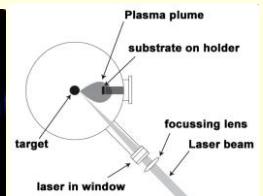
#### ■ Sistemas de evaporação

PLD 3000



PVD Products, Inc.

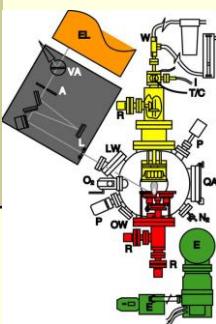
### PLD – deposição por laser pulsado



Wiki · H.Percwne 2006 (UTC)

Breakthrough: 1987 - Dijkkamp / Venkatesan  $\text{YBa}_2\text{Cu}_3\text{O}_7$

## Câmara PLD

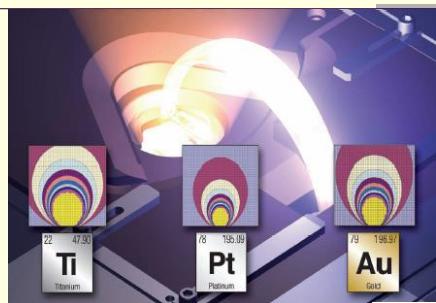


[www.ttk.fi/Units/AES/projects/plaser/en/equipment.htm](http://www.ttk.fi/Units/AES/projects/plaser/en/equipment.htm)



7

## Evaporação por feixe eletrônico

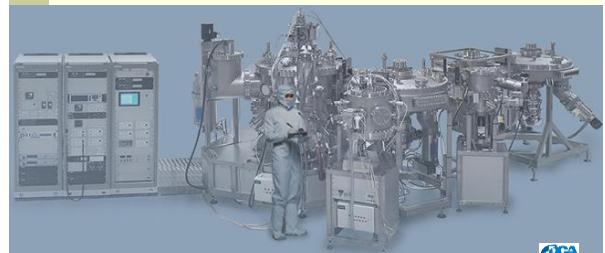


8

## Evaporação e-beam e convencional

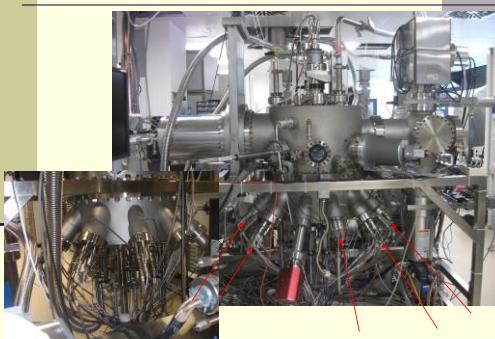


Micro Processadores / MQW-LEDs e LASERS:  
várias etapas – em ultra-alto-vácuo



10

## MBE – células de efusão



11

## Filmes por Evaporação Térmica

### ■ 3 etapas

- 1: Transformação de fase  
sólido ou líquido => vapor
- 2: Transporte  
fonte => substrato
- 3: Condensação e crescimento do filme

12

## Evaporação térmica

- Usada em diferentes processos
- Várias aplicações
- Importante para C & T

13

## Evaporação Térmica

- Importância da Evaporação em C & T / sistemas
- Termodinâmica da Evaporação / Condensação
- Evaporação em equilíbrio ↔ não equilíbrio
- Evaporação de ligas e compostos
- Demonstração da Eq. de Clausius e Clapeyron
- Exercícios / dúvidas
- Próxima aula:
  - Transporte,
  - Deposição no substrato
  - Monitoramento da deposição.

15

## Evaporação Térmica

- Importância da Evaporação em C & T / sistemas
- Termodinâmica da Evaporação / Condensação
- Evaporação em equilíbrio ↔ não equilíbrio
- Evaporação de ligas e compostos
- Demonstração da Eq. de Cláusius e Clapeyron
- Exercícios / dúvidas

16

## Evaporação Térmica

- Por que as substâncias evaporam / condensam?

17

## 1. Transformação de fase

Questões:

- Copo com água, Tamb. Evapora ? Por que?
- Forma de gelo – congelador. O que acontece ?
- Outra substância (Al, Au, Fe, Si....)



18



19

## condensação



20

■ Sob quais condições a substância tem tendência de evaporar?

■ “ “ “ tendência de condensar?

21

## Diagrama p-V-T

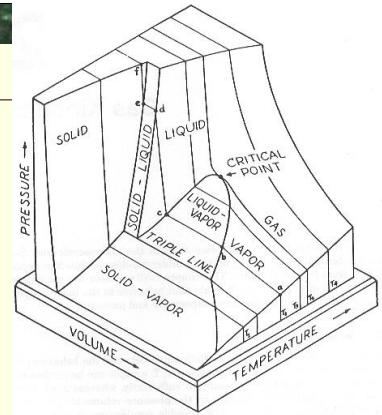
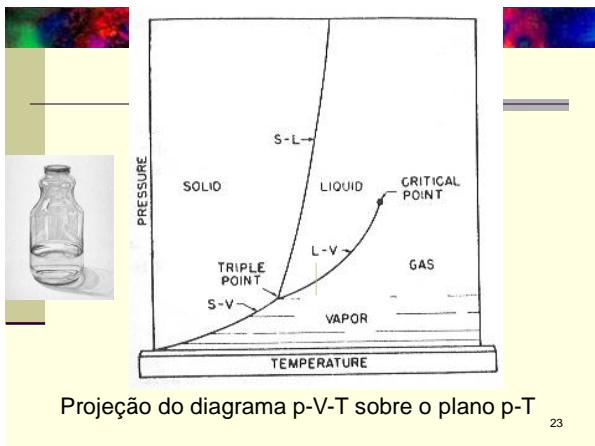


Diagrama p-V-T para uma quantidade fixa (1 mol) de material



Projeção do diagrama p-V-T sobre o plano p-T

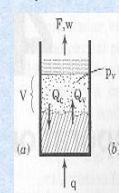
23

## Condição de Equilíbrio (?!)

- Como são a física e a química das transformações de fase?

⇒ Começaremos a abordar esse problema quando há equilíbrio de fases. (+ simples)

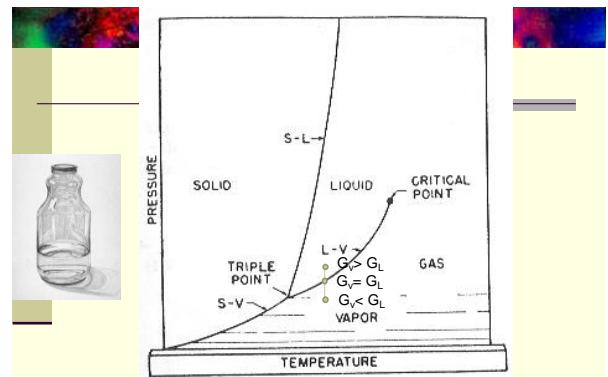
⇒ Depois veremos as condições de não equilíbrio => deposição de filmes (+ complexa)



## Questões:

- O que determina a evaporação / condensação / equilíbrio ?
- Como se define a temperatura de evaporação de uma substância ?
- Será que posso deduzir uma expressão que relaciona a pressão de vapor de equilíbrio com a temperatura ?

25



Projeção do diagrama p-V-T sobre o plano p-T

26

## Termodinâmica da Evaporação

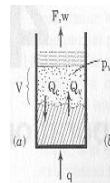
- Equação de Clausius e Clapeyron – (dedução => lista)

No equilíbrio :

$$dp \cong p \cdot \frac{\Delta H_{vap}}{R \cdot T^2} dT$$

 $\Delta H_{vap}$  =  $L_{vap}$ , calor latente de vaporização

27



$$\frac{dp}{p} \cong \frac{L_{vap}}{R \cdot T^2} dT \quad \text{Clausius e Clapeyron}$$

Integração

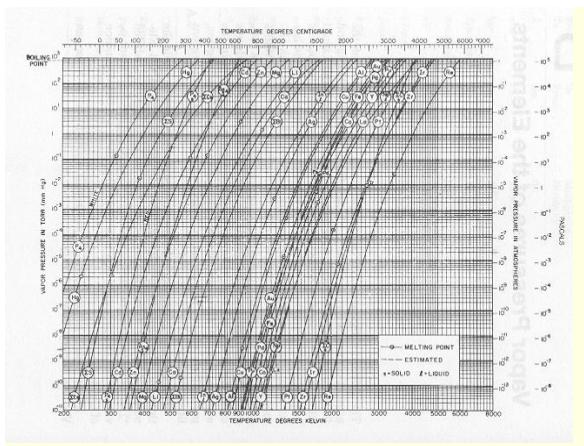
$$p(T) = p_o \cdot e^{-\frac{L_{vap}}{RT}}$$

 $p(T)$  - pressão de vapor de equilíbrio

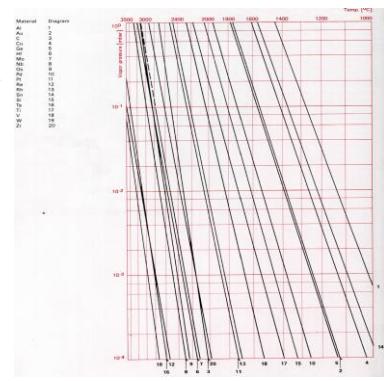
28

Será que funciona bem?

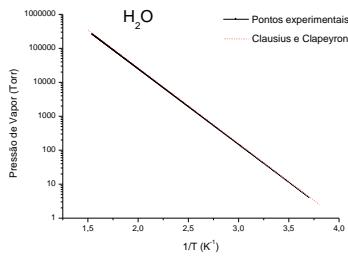
Será que funciona bem?



Pressões de vapor – metais.  
Catálogo Balzers



32



“temperatura de evaporação”

33

34

Na prática:  
(Ex: manual Balzers)

$$1 \times 10^{-2} \leq p_v \leq 1 \times 10^{-1} \text{ torr}$$

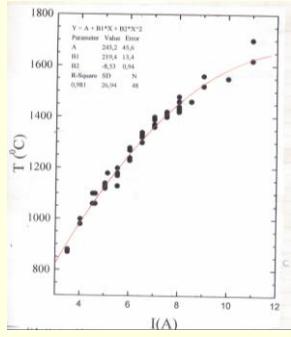
“temperatura de evaporação”  
(definição prática)

35

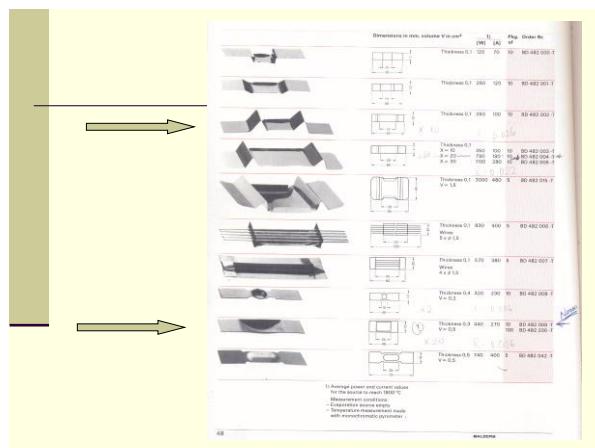
Technical data for evaporation and sputter coating									
Industries	Chemical	Density g/cm <sup>3</sup>	Melting pt	Boiling pt	Temperature in °C at vapor pressure in millibars	Substrate temperature in °C	Evaporation source or sputter gas	Sputtering rate nm/min	Comments
Aluminizing	Al	2.7	660	2467	1140	1270	DC	1	N, R, S, A1
Aluminizing	Al <sub>2</sub> O <sub>3</sub>	3.9	1291	—	820	880	DC	1	(Al <sub>2</sub> O <sub>3</sub> ) <sup>1</sup>
Aluminizing	Al <sub>2</sub> O <sub>3</sub> (90%)	2.7	660	—	1140	—	DC	1	
Aluminizing	Al <sub>2</sub> O <sub>3</sub> (95%)	3.9	1291	—	820	880	DC	1	
Aluminizing	Al <sub>2</sub> O <sub>3</sub> (99%)	4.0	2048	2090	2050	2200	DC	1	
Aluminizing	Al <sub>2</sub> O <sub>3</sub> (ZnO)	3.7	640	—	1120	—	RF	1	
Aluminizing	Al <sub>2</sub> O <sub>3</sub> (ZnO)	3.7	640	—	1120	—	DC	1	
Aluminizing	Al <sub>2</sub> O <sub>3</sub> (CaF <sub>2</sub> 10%)	3.7	640	—	1120	—	DC	1	
Aluminizing	Al <sub>2</sub> O <sub>3</sub> (CaF <sub>2</sub> 10%)	3.7	640	—	1120	—	RF	1	
Aluminizing	Si	2.3	830	1380	840	750	DC, RF	1	
Aluminizing	SiO <sub>2</sub>	2.2	1100	2200	1100	1200	DC	1	
Aluminizing	SiO <sub>2</sub> (99%)	2.2	1100	2200	1100	1200	DC	1	
Anodizing	Al <sub>2</sub> O <sub>3</sub>	3.4	300	307	490	825	DC	1	
Brazing	BeF <sub>2</sub>	4.9	1280	2280	1090	1270	DC	1	
Brazing	BeO	6.0	1800	—	1800	—	RF	1	
Brazing	BeO	6.0	2530	4120	2220	2400	DC	1	
Brazing	BeO	6.0	2530	4120	2220	2400	RF	1	
Brazing	BeO	6.0	2771	1580	480	310	DC	1	
Brazing	BeO	5.9	727	950	450	310	DC	1	
Brazing	BeO	5.9	727	950	450	310	RF	1	
Brazing	BeO <sub>2</sub>	6.0	820	1890	1660	—	DC	1	
Brazing	BeO <sub>2</sub>	6.0	820	1890	1660	—	RF	1	

- (1) Resist 5 g/cm<sup>2</sup> with C base
- (2) Resist with W
- (3) Resist with Ti
- (4) Minimum low-vac. evap. particles can be detected
- (5) DC
- (6) Flash evaporation
- (7) Thermal evaporation
- (8) Pulsed resist evap.

- Calibração (corrente no primário vs temperatura) – cadiño BD 482009-T



37



48

BD 482009

## Equação de Clausius e Clapeyron

- Todas as substâncias evaporam! (mesmo em equilíbrio há uma dinâmica)
- Equilíbrio vs. evaporação efetiva

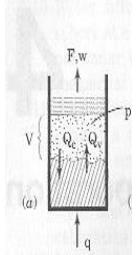
39

## Evaporação Térmica

- Importância da Evaporação em C & T / sistemas
- Termodinâmica da Evaporação / Condensação
- Evaporação em equilíbrio ↔ não equilíbrio
- Evaporação de ligas e compostos
- Demonstração da Eq. de Cláusius e Clapeyron
- Exercícios / dúvidas

40

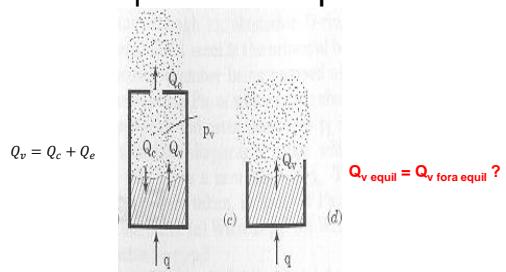
## Evaporação: equilíbrio



$$Q_v = Q_c + Q_e$$

41

## Evaporação: fora do equilíbrio

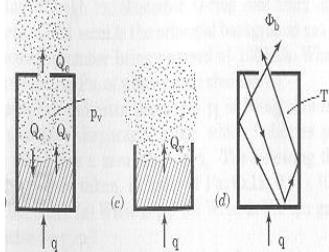


$$Q_v = Q_c + Q_e$$

$Q_v \text{ equil} = Q_v \text{ fora equil?}$

## Evaporação:

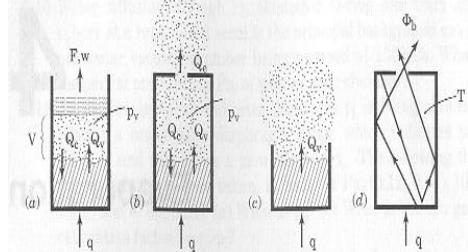
| fora do equilíbrio



radiação cavidade

## Evaporação:

equilíbrio | fora do equilíbrio

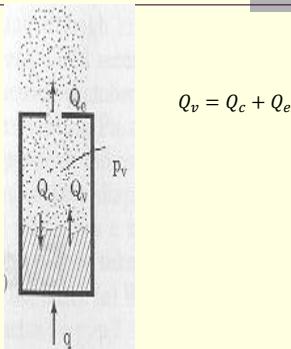


radiação cavidade

43

44

## Evaporação – célula de Knudsen



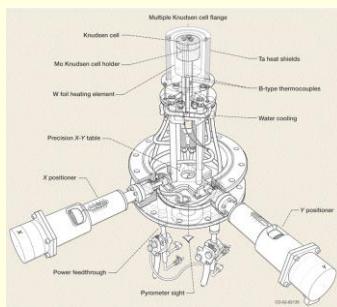
45

## Célula de Knudsen



46

## Célula de Knudsen - esquema

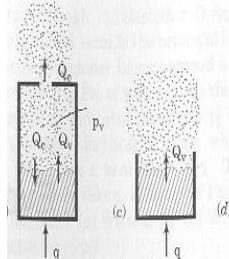


47

- Cadiño aberto : sistema mais simples
- Quais os potenciais problemas/desvantagens?

## Evaporação:

| fora do equilíbrio



Sistema fechado vs sistema aberto

- A taxa de evaporação muda muito?
- Problema da lista / exemplo  
=> evaporação da água em ebulição.



Pontos a acrescentar

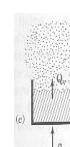
$\alpha_v$  - coef. de evaporação

$\alpha_v$  - coef. de evaporação

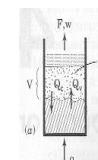
$\alpha_c$  - coef. de condensação

$$J_v = \alpha_v \cdot J_{vo}$$

$S_c$  -coef. de aderência  
(sticking coefficient)



$$Q_v = \text{área} \times J_v$$



$J_v$  – fluxo de evap fora do equilíbrio

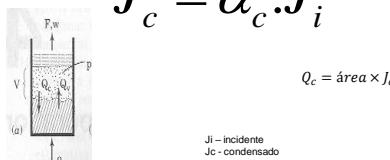
$J_{vo}$  – fluxo de evap no equilíbrio

$\alpha_c$  - coef. de condensação

pontos importantes - evaporação

- a evaporação depende fortemente da temperatura e do calor latente de vaporização
- é praticamente independente da incidência de moléculas de condensação  
=> podemos usar as pressões de vapor de equilíbrio para calcular as taxas de evaporação, cuidando do  $\alpha_c$

$$J_c = \alpha_c \cdot J_i$$



$$Q_c = \text{área} \times J_c$$

J\_i – incidente  
J\_c – condensado

Proximo: Evaporação de compostos e ligas

## Evaporação de compostos e ligas

- Ligas
- Compostos

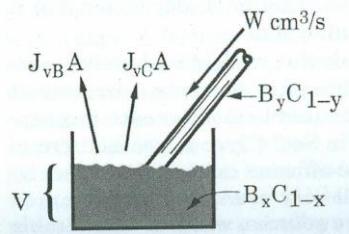
56

### LIGAS ( $A_xB_y$ )

Nas ligas geralmente os constituintes evaporam separadamente, com pressões de vapor distintas

57

## Evaporação de ligas



$$J_{vB}/J_{vC} (\text{cte}) \neq y/(1-y) \neq x/(1-x)$$

58

### COMPOSTOS ( $A_mB_n$ )

Nos compostos há casos em que moléculas são evaporadas mantendo a estequiometria, e outros em que os constituintes evaporam separadamente

59

## Evaporação de compostos

- Compostos que mantêm a estequiometria (+ simples)
- Compostos que evaporam fora da estequiometria (complicados)

60

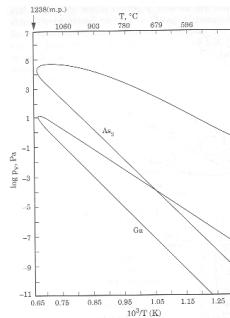
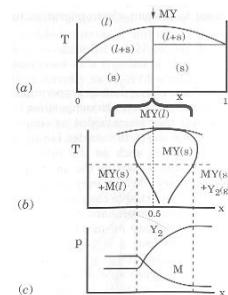


Figure 4.7 Equilibrium vapor pressures of Ga and As<sub>2</sub> along the GaAs liquidus, as functions of T. (Source: Reprinted from Ref.

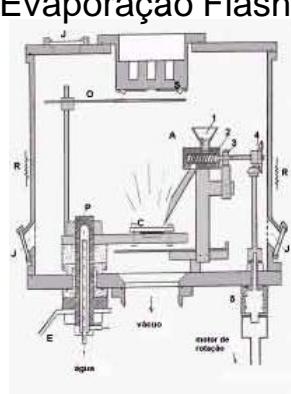


61

62



63



64

#### **Technical data for evaporation and sputter coating**

Na prática:  
(Ex: manual Balzers)

Substance Symbol	Density g/cm <sup>3</sup>	Melting point °C	Boiling point °C	Temperature in °C at which it begins to decompose in air	Refractive index at 589 nm as film at 25 °C	Explosive Severe- ity every grad. W Mto Wt. index	Spontan- eous igni- tion temper- ature ΔH <sub>ign</sub>	Com- muni- cations
Acrylonitrile Al	1.2	660	2467	1270	—	● (W)	IC 1	
Acrylonitrile-Al <sub>2</sub> O <sub>3</sub>	2.0	1291	2467	820	860	1.4	● (W)	IC 1 30, 41
Acrylonitrile-Al <sub>2</sub> SiC <sub>3</sub>	2.7	650	—	1160	—	—	—	IC 1
Acrylonitrile-Al <sub>2</sub> Zn <sub>3</sub>	4.0	200	2950	2050	2250	1.3	●	IF reactive
Acrylonitrile-Al <sub>2</sub> Zn <sub>3</sub> -Zn	2.7	640	—	1160	—	—	—	IF reactive
Acrylonitrile-Al <sub>2</sub> Zn <sub>3</sub> -Zn copper oxide	2.7	640	—	1160	—	—	—	IF reactive
Acrylonitrile-Al <sub>2</sub> Zn <sub>3</sub> -Zn copper oxide graphite	2.7	640	—	1160	—	—	—	IF reactive
Antimony Sb	6.7	630	1380	460	760	—	● (W)	IC 1
Antimony Sb <sub>2</sub> O <sub>3</sub>	6.7	650	1380	460	820	2.1	● (W)	IC, NF
Boron B <sub>2</sub> O <sub>3</sub>	4.6	850	1510	850	—	3.2	—	IC 1
Arsenic As <sub>2</sub> S <sub>3</sub>	3.4	300	707	495	825	—	● (W)	IC 1
Boron B <sub>2</sub> F <sub>6</sub>	4.3	1280	2280	1990	170	—	● (W)	IC 1
Boron B <sub>2</sub> O <sub>3</sub>	6.5	1600	—	1800	—	2.4	—	IF reactive
Boron B <sub>2</sub> O <sub>3</sub> -B <sub>2</sub> F <sub>6</sub>	6.5	1600	—	1800	—	2.4	—	IF reactive
Boron B <sub>2</sub> O <sub>3</sub> -Cu	6.5	1600	—	1800	—	2.4	—	IF reactive
Boron B <sub>2</sub> O <sub>3</sub> -Fe	3.0	2580	4120	2220	2400	—	● (W)	IF reactive
Boron B <sub>2</sub> O <sub>3</sub> -Mn	6.5	271	2580	1660	480	—	● (W)	IC 1 7)
Boron B <sub>2</sub> O <sub>3</sub> -Ti	6.5	727	1660	480	—	1.7	● (W)	IC 1 8)
Boron B <sub>2</sub> O <sub>3</sub> -Zn	6.5	820	1840	1660	—	1.9	● (W)	IF reactive

## Conclusões

- Equação de Clausius-Clapeyron ( $p_v - T$ )
  - Temp. de Evap  $\Rightarrow p_v \sim 10^{-1} - 10^2$  torr
  - Evap. aberta  $\Rightarrow J_v \sim J_{v-eq}$
  - Compostos e ligas – diferentes  $p_v$   
 $\Rightarrow$  flash, PLD

## Provocação / pergunta:

- A física da evaporação e condensação em um equipamento de MBE é mais complicada ou mais simples do que acontece em sua cozinha ?

... explique seus argumentos...

67

## Exercícios – Cap 4.

68